

(部門共通・運要 5-1-5)

(公募掲載様式)

委員会委員公募掲載様式

委員会名 (所属部門) 【技術委員会】	システム集積プロセス調査専門委 (C部門) 【電子デバイス技術委員会】	委員会での調査・検討項目の 概要，委員長のメッセージ等 (100字程度)	
設置期間	平成15年4月～平成18年3月	調査検討事項： ・ウエハ/多層基板材料開発技術 ・超微細リソグラフィ・薄膜形 成・エッチング技術 ・製造装置・評価分析技術 ・超高速・狭ピッチ・多ピン信号 配線技術 ・微細ビア加工・受動部品内蔵多 層基板形成集積化技術 ・光・無線回路システム集積技術 ・MEMSシステム技術 ・バイオ・ケミカルシステム技術 ・上記以外のシステム集積化に関 する周辺技術	
委員長名(所属)	森田瑞穂(大阪大学)		
委員会開催頻度	8回/年		
問合せ ・ 公募 受付 先	氏名 (所属)		横山道央 (山形大学)
	電話		0238-26-3315
	FAX	同上(兼用)	
	E-mail アドレス	yoko@yz.yamagata-u.ac.jp	
応募いただきたい方の専門分野， 経験など	委員会に参加し、無線・光からバイオ /ケミカルシステムまでの幅広いア プリケーション応用を見据えてLSI内 部・チップ・パッケージ含めた「シス テム集積化技術」全般における今後の 方向性を調査企画・討論できる方		
応募締切	平成15年8月31日		